

# 快速退火炉产品资料及技术规格

生产厂家：ECOPIA Corp.

型号：RTP-1300



## 一、主要技术规格

- 1、加热方式：红外卤素钨灯，1500瓦/支； Halogen Lamp, 1500W/ea;
- 2、卤灯数量：12支；
- 3、最快升温速率：80°C/Second；
- 4、最快降温速率：60秒(1000°C → 400°C)；
- 5、最高温度：1200°C；
- 6、温度精度：+/-1°C
- 7、均温性：±0.5% at 1000 °C across the 4" diameter wafer.
- 8、最大样品尺寸：4英寸；
- 9、工作环境：真空、引入气体(氮气，氩气，氧气，Forming Gas)、空气；in vacuum status, purge gas flow, ambient atmosphere；
- 10、真空泵及极限压力：机械泵，10<sup>-3</sup>Torr水平(Option)；
- 11、电压：220 V；
- 12、尺寸：500\*700\*580mm；
- 13、质量：净重57Kg；

## 二、仪器特点

- 可在真空/不同气氛/空气不同环境下，对样品进行快速热处理；
- 温控精度高；
- 适合高校或研究所科研使用；
- 台式设计；
- 仪器操作方便，样片装取容易；
- 价格合理，高性价比；

### 三、应用范围

- 快速热退火 (Rapid Thermal Annealing, RTA);
  - 快速热氧化 (Rapid Thermal Oxidation, RTO);
  - 快速热氮化 (Rapid Thermal Nitridation, RTN);
  - 硅化 (Silicidation);
  - 扩散 (Diffusion);
  - 化合物半导体退火 (Compound Semiconductor Annealing);
  - 离子注入后退火 (Implant Annealing);
  - 电极合金化 (Contact Alloying);
  - 晶向化和坚化 (Crystallization and Densification);
  - 合金熔点分析;
  - 薄膜沉积;
- 等等...

中国独家代理商:

上海载德半导体技术有限公司

SIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED

地址:上海市杨浦区松花江路251弄白玉兰环保广场7号602室

电话:021-6534 2985

传真:021-6534 2935

电邮:info@cross-tech.com.cn

<http://www.side-semi.com>